

国际先进光刻技术研讨会邀请函

International Workshop on Advanced Patterning Solutions Invitation Letter

光刻是集成电路制造领域的关键技术之一，也是衡量产业发展水平的重要指标。为了加强光刻技术领域的交流，促进业内合作，开拓研发思路，解决技术难题，推动行业发展，拟定于**2025年10月14-15日在深圳举办第九届“国际先进光刻技术研讨会 (International Workshop on Advanced Patterning Solutions)”**。本次会议由**中国集成电路创新联盟、中国光学学会**主办。会议将聚焦先进节点的热点问题，包括设计规则、光刻方案、光刻材料、掩模、设备、量测等。本次会议仍将是一次高水平的国际技术研讨会，会议的详细信息请参见会议官网 www.iwaps.org。

本次会议的发言人来自国内外业界的顶级专家。本次会议得到了国内外知名企业、研究机构 and 高校的大力支持。

我们很荣幸地邀请您参加本次大会。

会议相关事项：

1. 会议时间：2025年10月14-15日，13日报到。
2. 会议地点：深圳市五洲宾馆五洲厅（深圳市-福田区-深南大道6001号）。
3. 注册费用：3200元/人，9月30日前注册费：2800元/人。中国光学学会光刻技术专业委员会成员2400元/人，学生1600元/人。
4. 会议详情请及时登录本次会议官方网站，并请随时留意最新会议日程 (<https://www.iwaps.org/cn/index/7>)。
5. 亦可扫描右侧二维码进行报名。

期待您的莅临！

IWAPS 组委会

